

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7776377

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
RYOSUKE TANIGUCHI	03/26/2021
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.
Street Address:	6-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU
City:	TOKYO
State/Country:	JAPAN
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	17331848
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Email:	patentmail@WHDA.com
Correspondent Name:	WHDA, LLP
Address Line 1:	8500 LEESBURG PIKE, SUITE 7500
Address Line 4:	TYSONS CORNER, VIRGINIA 22182
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	P210453US00
NAME OF SUBMITTER:	SHUJI YOSHIZAKI
SIGNATURE:	/Shuji Yoshizaki/
DATE SIGNED:	02/02/2023
Total Attachments: 2	
source=20074US Invent or Devise Written Notice Assignment (English Translation)#page1.tif	
source=20074US Invent or Devise Written Notice Assignment#page1.tif	

Invention or Device WRITTEN NOTICE / ASSIGNMENT

Receipt No: 2020-0127-JP01
The Date of Receipt: March 26, 2021

We report our invention or device as follows, and transfer all of the member's share of the right to a Patent and the right to a utility model registration in Japan and foreign countries to you.

1. Title of the invention: Pattern Forming Process and Pattern Forming Method

2. Inventor/Designer

Name	Employee No	Name	Employee No
	Equity (%)		Equity (%)
① Naoya INOUE Seal	18380	④ Masahiro FUKUSHIMA Seal	15514
	50		15
② Satoshi WATANABE Seal	02742		
	20		
③ Ryosuke TANIGUCHI Seal	14182		
	15		

3. Summary of the invention (Inventor)

The present invention relates to a benzene sulfonate-type onium salt including a polarity switching unit, and a negative resist composition. It is expected for EB negative resist. The resist has good sensitivity, LWR and rectangularity since it becomes hydrophobic by exposure.

Name: Naoya INOUE

(The rest is omitted)

下記の発明・考案を為したので届出るとともに、これらについて、日本及び外国における特許・実用新案を受ける権利のそれぞれの持分すべてを貴社に譲渡致します。

1. 発明・考案の名称		オニウム塩化合物、レジスト組成物及びパターン形成方法					
2. 発明・考案者	英字綴り (ブロック体)	社員No.	所属	英字綴り (ブロック体)	社員No.	所属	
	氏名	持分%		氏名	持分%		
	① INOUE NAOYA 井上直也 (印)	16380 50	新機研	④ RIKUCHIYA MASAHIRO 福島将大 (印)	15574 15	新機研	
	② WATANABE SATO 渡邊聡 (印)	02742 20	"	⑤	印		
③ TANIGUCHI KYOSUKE 谷口良輔 (印)	14192 15	:	⑥	印			
上記の持分%は、発明者全員の合意・承諾の上、定めたものです。							
3. 発明・考案の要旨 (発明者)	極性変化単位を含有するベンゼンスルホネート型のオニウム塩。及び前記オニウムを用いた本レジスト組成物の特許。EBネガレジスト用途を想定。露光後に疎水性が向上することから特に感度、LWR、矩形性に優れる。 (氏名) 井上直也 (印)						
	4. 発明・考案の状況及び今後の予定	(イ) 着想のみ (ロ) 研究 (中) 了 (ハ) 工業化 (準備中・実施中)					
5. 関連製品名	EBレジスト、EUVレジスト、マスクブランクス						
6. 社内外発表の現況	① 未発表 (ロ) 発表 (a. 社内報告No. b. 学会発表・その他)						
7. 出願公開	① 差支えなし (ロ) 困る (a. 社内/外とする b. その他)						
8. 出願希望日	① 普通 (ロ) 特に急ぐ (迄) (理由)						
9. 総合評価	A. 秀 B. 優 C. 良 D. 防衛						
10. 発明部門意見欄	PAGに関する特許。三級アルコール部を有するベンゼンスルホネート型オニウム塩。酸の作用によりアルコールが脱水することでアルカリ不溶性となる。EBネガレジストに好適で解像性能に優れるため権利化を進めたい。 (氏名) 大橋正樹 (印)						
11. 発明部門整理No.	N2003261			12. 発明部門受付日	2020年3月26日		
13. 研究テーマコード	2711-792-66			14. 開発室コード			
15. 他社との取決め	・無 単願 (他社との取り決めが有っても単願にする場合にはその内容を下記備考欄に記載して下さい)						
	・有 共願 会社名 () 費用負担 (%) 権利持分 (%)						
16. 本社関連部門意見欄	(氏名) 印						
17. 第1出願国	国内 () 外国 (WO US) () その他の外国の場合は国を記入して下さい。						
18. 備考	2020-0119 と同日出願を希望します。			19. 代理人: 英明			
検印	特許部		本社関連部門 (新機研)		発明部門 (新機研)		
	部長	合議	責任者/特許実行委員		責任者	特許実行委員 特許担当者	
				(由利)	(壽)	(印)	

山崎C-様へ1 (2017.02.16改訂版)

PATENT